

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年1月26日 (26.01.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/009285 A1

- (51) 国際特許分類: C08G 63/06,
63/91, C08K 7/02, C08L 67/04 // 101/16
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/013672
- (22) 国際出願日: 2005年7月20日 (20.07.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-214496 2004年7月22日 (22.07.2004) JP
特願2004-230978 2004年8月6日 (06.08.2004) JP
特願2004-252804 2004年8月31日 (31.08.2004) JP
特願2004-378709
2004年12月28日 (28.12.2004) JP

(JP). 野々川 竜司 (NONOKAWA, Ryuji) [JP/JP]; 〒740-0014 山口県 岩国市 日の出町 2 番 1 号 帝人株式会社 岩国研究センター内 Yamaguchi (JP). 前田 康人 (MAEDA, Yasuhito) [JP/JP]; 〒770-0822 徳島県 徳島市 東出来島町 4 0-1-1 0 0 3 Tokushima (JP). 高田 昌幸 (TAKADA, Masayuki) [JP/JP]; 〒104-0031 東京都 中央区 京橋 1 丁目 1 番 1 号 株式会社武蔵野化学研究所内 Tokyo (JP). 駒沢 友香 (KOMAZAWA, Yuka) [JP/JP]; 〒104-0031 東京都 中央区 京橋 1 丁目 1 番 1 号 株式会社武蔵野化学研究所内 Tokyo (JP). 青木 強志 (AOKI, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒104-0031 東京都 中央区 京橋 1 丁目 1 番 1 号 株式会社武蔵野化学研究所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大島 正孝 (OHSHIMA, Masataka); 〒160-0004 東京都 新宿区 四谷四丁目 3 番地 福屋ビル 大島特許事務所 Tokyo (JP).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 帝人株式会社 (TEIJIN LIMITED) [JP/JP]; 〒541-0054 大阪府 大阪市 中央区南本町 1 丁目 6 番 7 号 Osaka (JP). 株式会社武蔵野化学研究所 (MUSASHINO CHEMICAL LABORATORY, LTD.) [JP/JP]; 〒104-0031 東京都 中央区 京橋 1 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP). 株式会社ミューチュアル (MUTUAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒534-0025 大阪府 大阪市 都島区片町 2 丁目 9 番 2 8 号 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人 および
(72) 発明者: 木村 良晴 (KIMURA, Yoshiharu) [JP/JP]; 〒523-0891 滋賀県 近江八幡市 鷹飼町 1 1 2 6-1 番地 Shiga (JP).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 唐 振 (TANG, Zhen) [CN/JP]; 〒104-0031 東京都 中央区 京橋 1 丁目 1 番 1 号 株式会社武蔵野化学研究所内 Tokyo (JP). 福島 和樹 (FUKUSHIMA, Kazuki) [JP/JP]; 〒664-0871 兵庫県 伊丹市 堀池字タカセキ 7 4-2 2 Hyogo (JP). 豊原 清綱 (TOYOHARA, Kiyot-suna) [JP/JP]; 〒740-0014 山口県 岩国市 日の出町 2 番 1 号 帝人株式会社 岩国研究センター内 Yamaguchi

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYLACTIC ACID AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: ポリ乳酸およびその製造方法

(57) Abstract: A polylactic acid that contains a stereocomplex crystal, excelling in moldability and that has a high molecular weight, high crystallinity and high melting point; and a process for producing the same. Further, there are provided a composition of the polylactic acid and a molding thereof. In particular, there is provided a polylactic acid of 8 to 50×10^4 weight average molecular weight wherein in the measurement by means of differential scanning calorimeter (DSC), the ratio of $\geq 195^\circ\text{C}$ melting peak to all melting peaks during temperature rise step is $\geq 80\%$, and provided a process for producing the same.

(57) 要約: 本発明の目的は、ステレオコンプレックス結晶を含有し、成形加工性に優れ、高分子量で、高結晶性で、高融点のポリ乳酸およびその製造方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、該ポリ乳酸の組成物、成形品を提供することにある。本発明は、重量平均分子量が $8 \sim 50$ 万で、示差走査熱量計 (DSC) 測定において、昇温過程における融解ピークのうち、 195°C 以上の融解ピークの割合が 80% 以上であるポリ乳酸およびその製造方法である。



WO 2006/009285 A1